

新規事業のお知らせ

“アルゴンエキシマ光洗浄プロセス装置”

株式会社エス・イー・アール

平成 30 年 7 月 1 日

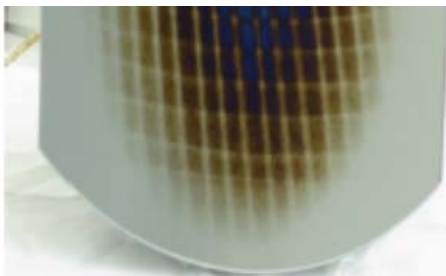
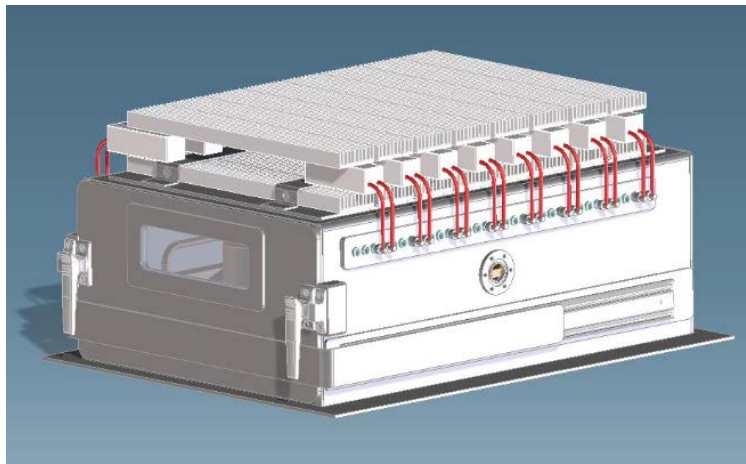
株式会社エス・イー・アールは、株式会社 NTP より技術供与を受けアルゴンエキシマ極端紫外光による大型平面照射光源を搭載した物体表面光洗浄プロセス装置の販売を開始しました。

当該プロセス装置は、極端紫外光によるドライプロセスであり、洗浄対象物の無損傷洗浄が特徴で、アルゴンエキシマ極端紫外光(波長=126nm)の光子エネルギーによって物体表面に付着した有機汚染物の分子結合を断ち切り、表面洗浄、表面改質、親水性などの効果をソフトプロセスで実現します。

昨今半導体の微細化が進み、これに伴い EUV リソグラフィ装置や EUV マスク欠陥検査装置等に注目が集まっていますが、その装置内で使用される EUV 集光ミラーの反射面汚れの問題が顕在化しています。反射面の汚れは、装置のダウンタイム増加の精度劣化の主要因となり得るものとして最適な解決策が求められています。

本事業、装置のターゲットは、上記の様な場面におけるドライプロセスでのソフト洗浄工程用途です。下図資料で紹介されているように、汚染された鏡面がドライ&ソフトプロセスにより、初期の鏡面に復元できます。

アルゴンエキシマ極端紫外光 平面照射光源



カーボン汚染された EUV ミラー



アルゴンエキシマ極端紫外 24H 光照射後

尚、本装置(大鏡面用)の製品化は平成 30 年末を予定しています。

以上